(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年10月21日(21.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/090087 A1

(51) 国際特許分類7:

C11D 13/16

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/004807

(22) 国際出願日:

2004年4月1日(01.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-104582 特願2003-104584 2003 年4 月8 日 (08.04.2003) 2003 年4 月8 日 (08.04.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 花王株 式会社 (KAO CORPORATION) [JP/JP]; 〒103-8210 東 京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中野 尚 (NAKANO, Takashi) [JP/JP]; 〒 321-3497 栃木県 芳 賀郡 市貝町赤羽 2606 花王株式会社研究所内 Tochigi (JP). 小玉 伸二 (KODAMA,Shinji) [JP/JP]; 〒 321-3497 栃木県 芳賀郡 市貝町赤羽 2 6 0 6 花王株 式会社研究所内 Tochigi (JP).

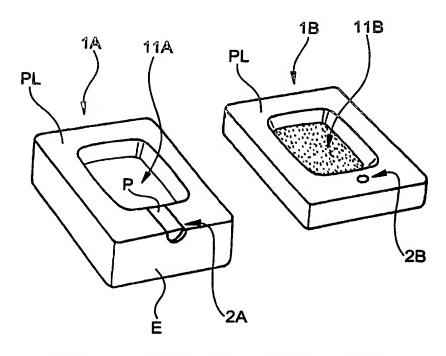
(74) 代理人: 羽鳥 修, 外(HATORI,Osamu et al.); 〒107-0052 東京都港区 赤坂一丁目8番6号 赤坂HKNピ ル6階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

/続葉有/

(54) Title: SOAP-MOLDING DIE

(54) 発明の名称: 石鹸の成形型



(57) Abstract: A soap-molding die is composed of a set of split dies (1A, 1B) assembled together, and inside of the molding die is a molding cavity (1C). The surface area of a recess (11A) forming the cavity in one spilt die (1A) is made larger than the surface area of a recess (11B) in each of the other split dies (1B), and the ratio between the surface area of the recess (11A) in the one split die (1A) and the surface area of the recess (11B) in each split die (1B) is set 52:48 - 66:34. Further, surface roughness (Ra) of the recess (11A) is made greater than surface roughness (Ra) of the recess (11B), and the difference between the surface roughness (Ra) of the recesses is set $0.1 - 30 \mu m$.

(57) 要約: 一組の割型1A,1Bを組 み付けてなり、内部に成形用の キャピティICが形成される石鹸 の成形型を開示する。一の割型

1Aにおける前記キャビティを形成する凹部11Aの表面積を、他の各割型1Bにおける前記キャビティを形成する凹部 ○ 11Bの表面積よりもそれぞれ大きくし、一の割型1Aにおける凹部11Aの表面積と、他の各割型1Bにおける凹部11B の表面積との比をそれぞれ52:48~66:34とした。また、一の割型1Aにおけるキャピティを形成する凹部11Aの表面 粗さRaを、他の各割型1Bにおけるキャピティを形成する凹部11Bの表面粗さRaよりもそれぞれ大きくし、それらの 📐 衷面粗さRaの差をそれぞれ0.1~30μmとした。

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。 WO 2004/090087 PCT/JP2004/004807

1

明 細 書

石鹸の成形型

技術分野

本発明は石鹸の成形型に関する。

5 背景技術

15

20

本出願人は先に、脱型時に表面剥離等の欠損が生じることなく、表面の仕上がり性に優れた気泡入り石鹸を製造する方法を提案した(特開2002-121599号公報参照)。この方法においては、成形型に充填した溶融石鹸をその表面温度が5~30℃になるまで冷却固化させ、10 固化した石鹸を、表面温度が冷却終了時の表面温度よりも2~15℃高い温度に昇温させた後に脱型する。その際、成形型として内面の表面粗さRaが0.1~30μmのものを用いる。

前記の製造方法によれば、通常の石鹸よりも欠損が生じやすい気泡入り石鹸であっても首尾良く脱型することができる。しかし成形型の型開時に、固化した石鹸が割型に保持されず落下しやすくなってしまう。落下すると、石鹸は容易に破損してしまい、これが原因で装置が汚染されてしまう。従って、石鹸の割型への保持は確実に行う必要がある。また、落下しないまでも、型開時に石鹸が保持される割型がまちまちとなりやすい。その結果、取り出し装置による石鹸の取り出し工程が煩雑になりやすく、それが原因で生産性が低下してしまう。

そこで、割型の凹部に異なる離型性を有するコーティングを施し、割型への石鹸の付着性に差が生じるようにすることが提案されている(特表2001-525881参照)。しかし、このような割型を用いると、成形を重ねるにつれコーティングが剥離していき、付着性に差が生じな

くなってしまう。従って、定期的に割型にコーティングを施す必要があ り、作業が煩雑になるとともに、製造経費も高くなってしまう。

発明の開示

本発明は、一組の割型を組み付けてなり、内部に成形用のキャビティが形成される石鹸の成形型を提供するものである。この成形型においては、一の割型における前記キャビティを形成する凹部の表面積を、他の各割型における前記キャビティを形成する凹部の表面積よりもそれぞれ大きくし、一の割型における前記凹部の表面積と、他の各割型における前記凹部の表面積との比をそれぞれ52:48~66:34としてある。

10 また本発明は、一組の割型を組み付けてなり、内部に成形用のキャビ ティが形成される石鹸の成形型において、一の割型における前記キャビ ティを形成する凹部の表面粗さ Raを、他の各割型における前記キャビ ティを形成する凹部の表面粗さ Raよりもそれぞれ大きくし、それらの 表面粗さ Raの差をそれぞれ 0.1~30μmとした石鹸の成形型を提 15 供するものである。

更に本発明は、前記の成形型のキャビティ内に溶融石鹸を加圧注入 し、該溶融石鹸を圧縮状態下に冷却固化させた後、該成形型を型開して 固化した石鹸を取り出す石鹸の製造方法を提供するものである。

図面の簡単な説明

20 図1は、本発明の石鹸の成形型の一実施形態を示す斜視図である。

図2(a)~図2(d)はそれぞれ、図1に示す成形型を用いた気泡入り石鹸の製造方法を示す模式図である。

図3は、本発明の石鹸の成形型の別の実施形態を示す斜視図 (図1相 当図)である。

発明の詳細な説明

本発明は、型開時に、成形された石鹸が常に特定の割型に保持される 成形型に関するものである。

以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。図1に示す石鹸の成形型は、第1の割型1A及び第2の割型1Bからなる2個の割型で一組をなしている。各割型は金属等の剛体からなる矩形プロック状の形態をしており、それぞれの中央部に凹部11A及び11Bが形成されている。各凹部11A,11Bは、第1の割型1Aと第2の割型1Bとをそれらのパーティング面PLで突き合わせたとき、製造すべき石鹸の形状に合致した形状のキャビティ(図示せず)が形成されるように、各割型に形成されている。また凹部11A,11Bは非対称な形状をしている。具体的には第2の割型1Bの凹部11Bよりも、第1の割型1Aの凹部11Aの方が大きくなっている。更に凹部11A,11Bは何れもアンダーカット部分が存在しない形状となって15いる。

第2の割型1Bには、該第2の割型1Bをその厚さ方向に貫通するノズル挿入孔2Bが、凹部11Bの外縁部に穿設されている。ノズル挿入孔2Bは、その径が、第2の割型1Bの背面側に向かうに連れ漸次拡開している。一方、第1の割型1Aには、そのパーティング面PLの一部 が凹設されて形成された半円柱形状のゲート2Aが形成されている。ゲート2Aは第1の割型1Aの端面Eと凹部11Aとを連通させている。ゲート2Aには、該ゲート2Aと相補形状をなすピストンPが嵌挿されている。ピストンPは金属又はプラスチック等の材質からなり、ゲート2A内を摺動可能になされている。ノズル挿入孔2Bとゲート2Aとは、第1の割型1Aと第2の割型1Bとをそれらのパーティング面PLで突き合わせたときに、ノズル挿入孔2Bからゲート2Aを経てキャビティへと達する連通路が形成されるような位置にそれぞれ形成されてい

る。図示していないが、第2の割型1Bのパーティング面PLにはエアベントが設けられている。また、図示していないが、両割型1A,1B を構成するプロックには冷却水の循環路が設けられている。

先に述べたように、第1の割型1Aの凹部11Aと第2の割型1Bの凹部11Bの凹部とは非対称形状となっており、第1の割型1Aの凹部11Aは、第2の割型1Bの凹部11Bよりも大きくなっている。その結果、第1の割型1Aの凹部11Aの表面積が、第2の割型1Bの凹部11Bの表面積よりも大きくなっている。

第1の割型1Aの凹部11Aの表面積を、第2の割型1Bの凹部11 Bの表面積よりも大きくすることで、溶融石鹸をキャビティ内に充填し 冷却固化させた後に成形型を型開するときに、凹部の表面積の大きな第 1の割型1A側に石鹸が常に保持されることが本発明者らの検討の結果 判明した。

第1の割型1Aの凹部11Aの表面積を、第2の割型1Bの凹部11 15 Bの表面積よりも大きくすればするほど、第1の割型1A側に石鹸が保 持されやすい。しかし、両凹部11A、11Bの表面積の差が過大でな くても、第1の割型1A側に石鹸が確実に保持されることが本発明者ら の検討によって判明した。これとは別に、第1の割型1Aの凹部11A の表面積を、第2の割型1Bの凹部11Bの表面積よりも大きくすれば するほど、第1の割型1Aの凹部11Aの形状と第2の割型1Bの凹部 20 11 Bの形状が大きく異なってしまい、成形された石鹸の外形が大きく 非対称になってしまう。その結果、石鹸の美観が低下するおそれがある。 また成形を行い難くなる場合もある。しかも、各割型の製造も複雑にな る。そこで本発明においては、第1の割型1Aにおける凹部11Aの表 25 面積と、第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面積との比を52:4 8~66:34、好ましくは52:48~57:43とすることで、各

凹部11A, 11Bの形状を大きく異ならせることなく、即ち成形された石鹸の外形を過度に非対称とすることなく、第1の割型1A側に石鹸を常に保持させ得ることが判明した。

第1の割型1A側に石鹸を一層確実に保持させるために、第2の割型 1 Bにおける凹部11Bの表面粗さRaを、第1の割型1Aにおける凹部11Aの表面粗さRaよりも大きくすることが有利であることが本発明者らの検討により判明した。先に述べた特開2002-121599 号公報に記載されているように、凹部の表面粗さRaを低下させるとその割型側に石鹸が保持される。つまり表面粗さRaを大きくするとアンカー効果によってその割型側に石鹸が保持される。つまり表面粗さRaの大小によって石鹸が保持される割型がまちまちとなってしまう。本発明者らが鋭意検討した結果、第1の割型1Aにおける凹部11Aの表面粗さRaと、第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面粗さRaとの差を好ましくは0.1~30μm、更に好ましくは0.2~20μmとすることで、表面粗さRaの低い第1の割型1A側に石鹸が一層確実に保持されることが判明した。

第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面粗さRaを、第1の割型1Aにおける凹部11Aの表面粗さRaよりも大きくするために、本実施形態の成形型においては、各割型1A,1Bにおける凹部11A,11Bの内面をそれぞれ鏡面加工して、各内面を同程度の低表面粗さの領域となし、これと共に一方の割型である第2の割型1Bにおける凹部11Bの底面を、鏡面加工後に粗面加工して高表面粗さの領域となしている。粗面加工としては例えばサンドブラスター加工などが用いられる。

図1に示されるように、第2の割型1Bの凹部11Bに形成される高 25 表面粗さの領域は、該凹部11Bの底面に位置している。つまり高表面 粗さの領域は、成形型のパーティング面PLとほぼ平行な面である凹部 WO 2004/090087 PCT/JP2004/004807

6

11Bの底面に形成されている。これによって、第2の割型1Bからの石鹸の離型が容易となり、第1の割型1A側に石鹸が一層確実に保持される。ほぼ平行な面とは、凹部11Bの底面が平坦面であることを要せず、石鹸に特有の形状である曲面となっていてもよいことを意味する。

- 5 第1の割型1A側に石鹸を一層確実に保持させるために、第2の割型 1Bの凹部11Bにおける高表面粗さの領域は、該凹部11Bの全面積 の30%以上、特に50%以上を占めることが好ましい。最も好ましく は、第2の割型1Bの凹部11Bはその全域が高表面粗さの領域となっ ている。
- 10 また、第1の割型1A側に石鹸を一層確実に保持させるために、第2の割型1Bの凹部11Bにおける高表面粗さの領域は、その表面粗さR aが 0・2~30μm、特に 0・4~20μmであることが好ましい。一方、第2の割型1Bにおける凹部11Bの低表面粗さの領域の表面粗さR a は何れも 2 0 μmであることが好ましい。なお、第2の割型1Bにおける凹部11Bの低表面粗さの領域の表面粗さR a と、第1の割型1Aにおける凹部11Bの低表面粗さの領域の表面粗さR a と、第1の割型1Aにおける凹部11Aの表面粗さR a とは必ずしも同じ値であることを要しない。しかし、各割型1A,1Bの製造経費等を考慮すると各割型1A,1Bには同様の鏡面加工を施すことが通常であることから、結果的に両者の表面粗さR a は先に述べた通りほぼ同程度となる。

更に、第1の割型1A側に石鹸を一層確実に保持させるために、第2の割型1Bの凹部11Bにおける高表面粗さの領域の表面粗さRaと、第1の割型1Aにおける凹部11Aの表面粗さRaとの比(前者/後25 者)は1.003~300、特に1.01~100であることが好ましい。

表面粗さRaはJIS B0601に従い測定される。測定装置としては例えば(株)東京精密製の表面粗さ測定機SURFCOM590Aを用いることができる。

次に図1に示す成形型を用いた石鹸の製造方法を、気泡入り石鹸の製 5 造を例にとり図2を参照しながら説明する。図1に示す成形型は図2に 示す製造装置に取り付けられて使用される。この製造装置は金型ユニッ ト4Aと、溶融石鹸の注入装置3Aとを備えている。成形型は、図2(a) に示すように、金型ユニット4Aのベースプレート40上に取り付けら れる。ベースプレート40上には第1の割型1Aの支持板41及び第2 の割型1Bの支持板42がそれぞれ立設されている。支持板41の内面 には、ピストン43を備えたシリンダ44が取り付けられている。シリ ンダ44は、ピストン43が支持板41と直交する方向に摺動するよう に取り付けられている。ピストン43の先端は第1の割型1Aの背面に 固定されている。従って、第1の割型1Aは水平方向に移動可能な移動 型となっている。また第1の割型1Aは、そのゲート2A側を下方に向 けた状態で固定されている。第1の割型1Aの背面部における下方部に は、L字形をしたシリンダ保持板45が取り付けられている。シリンダ 保持板45における水平部には、ピストン46を備えたシリンダ47が 取り付けられている。シリンダ47は、ピストン46が上下方向に摺動 するように取り付けられている。ピストン46の先端は、第1の割型1 Aに備えられたピストンPに接続されている。

第2の割型1Bは、その凹部11Bが第1の割型1Aの凹部11Aと対向するように且つノズル挿入孔2Bを水平方向に向けた状態で、支持板42に取り付けられている。図2(a)から明らかなように、第2の割型1Bは固定型となっている。第2の割型1Bの背面側には、溶融石鹸の注入装置3Aが取り付けられている。注入装置3Aは、注出ノズル31、切り替えバルブ32、シリンダ33、及びシリンダ33内に配さ

れたピストン34を備えている。注出ノズル31は、第2の割型1Bに 穿設されたノズル挿入孔2Bの形状と合致した形状をしており、該ノズ ル挿入孔2B内に挿入されている。注出ノズル31の内部にはゲートピン35が摺動自在に挿入されており、ゲートピン35の押し込み及び引き出しによって、注出ノズル31からキャビティへの溶融石鹸の注入を制御している。切り替えバルブ32は、シリンダ33を、図示しない貯蔵タンク内を経由する循環路36及び注出ノズル31の何れかに一方に択一的に連通させるものである。図2(a)に示す状態では、シリンダ33と循環路36との連通は遮断されている。

図 2 に示す製造装置を用いた気泡入り石鹸の製造方法について説明す ると、先ず金型ユニット4Aのシリンダ44を動作させてピストン43 を押し出して、第1の割型1Aと第2の割型1Bとを型閉する。両割型 には、前述した冷却水の循環路に水を循環させておく。また、シリンダ 47を動作させてピストン46を引き込み、これによって該ピストン4 15 6に接続されているピストンPの一部を第1の割型1Aから引き出して おく。一方、注入装置3Aにおいては、ピストン34を押し込んだ状態 にしておき、この状態下に切り替えバルブ32を操作して、シリンダ3 3と循環路36とを連通させる。そしてピストン34を引き出してシリ ンダ33内に所定量の溶融石鹸を送り込む。溶融石鹸は、図示しない貯 蔵タンクに貯えられており、該貯蔵タンク内を経由する循環路36内を 循環している。そして、切り替えバルブ32による流路切り替えによっ て、循環している溶融石鹸がシリンダ33内に送り込まれる。溶融石鹸 を循環させておくことで、溶融石鹸中の気泡と液体分との分離が効果的 に防止される。無数の気泡を分散含有する溶融石鹸の調製方法として は、例えば本出願人の先に出願に係る特開平11-43699号公報の 第2欄15行~第5欄1行に記載されている方法を用いることができ

る。溶融石鹸の発泡には各種気体を用いることができる。特に不活性気体、とりわけ窒素ガス等の非酸化性の不活性ガスを用いることで、溶融石鹸の加熱に起因してその配合成分が劣化ないし酸化分解することで発生する異臭等を、効果的に防止することができる。

5 次いで切り替えバルブ32を操作して、図2(a)に示すように、シリンダ33と循環路36との連通を遮断し且つシリンダ33と注出ノズル31とを連通させる。ゲートピン35は引き出された状態にしておく。引き続き、ピストン34を押し込んで、シリンダ33内の溶融石鹸4を押し出す。これによって溶融石鹸4は注出ノズル31及びゲート210 A(図1参照)を通じてキャビティ11C内に加圧注入される。この加圧注入によって、キャビティ11C内の溶融石鹸は所定の体積まで圧縮される。

所定体積の溶融石鹸の加圧注入が完了したら、図2(b)に示すようにゲートピン35を押し込んで注出ノズル31とキャビティ11Cとの連通を遮断する。更に、シリンダ47を動作させてピストン46を押し出し、該ピストン46に接続されているピストンPをゲート2A(図1参照)内に押し込む。これによって、ゲート2A内に残存している溶融石鹸をキャビティ11C内に注入する。

溶融石鹸が固化したら、図2(d)に示すように、シリンダ44を動作させてピストン43を引き込む。これによって両割型1A,1Bを型開し、次いでキャビティ内の気泡入り石鹸5を所定の把持手段(図示せず)によって取り出す。この場合、石鹸5は常に第1の割型1A側に保5持される。従って、把持手段による石鹸5の取り出しは常に第1の割型1A側に対して行えばよいので、取り出しが容易となり生産性が向上する。しかも型開に際して石鹸の落下も起こらないので、落下した石鹸から生じた破片等によって製造装置が汚染されることもない。また各割型1A,1Bの凹部11A,11Bは非対称の異形状となっているが、これらの凹部にはアンダーカット部が存在しないので、型開時にいわゆる無理抜きを行う必要はない。

溶融石鹸の冷却固化後に成形型を型開する時期に特に制限はないが、 石鹸の内部までが固化してから型開するよりも、もっと早い段階、例え ば石鹸の表層部は固化しているが内部は未固化の状態で型開する方が、 15 石鹸は確実に第1の割型1A側に保持される。

次に、本発明の別の実施形態について図3を参照しながら説明する。この実施形態に関し、特に説明しない点については、先の実施形態に関して詳述した説明が適宜適用される。また、図3において、図1と同じ部材に同じ符号を付してある。図3に示す実施形態の成形型は、図1に20 示す成形型とほぼ同様に構成されている。両者が異なる点は、実施形態の成形型においては、凹部11A,11Bがほぼ対称な同形状をしている点である。

各割型1A, 1Bにおける凹部11A, 11Bの内面はそれぞれ鏡面加工されて低表面粗さの領域となっている。但し、一方の割型である第 1の割型1Aにおいては、その凹部11Aの底面が、鏡面加工後に粗面加工されて高表面粗さの領域となっている。即ち本実施形態において

は、第1の割型1Aにおける凹部11Aの表面粗さRaを、第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面粗さRaよりも大きくしてある。

更に、第1の割型1Aの凹部11Aには、高表面粗さの領域と低表面粗さの領域とがあり、一方第2の割型1Bの凹部11Bには低表面粗さの領域のみがある。そして、第1の割型1Aの凹部11Aにおける低表面粗さの領域の表面粗さRaは、第2の割型1Bの凹部11Bの表面粗さRaとほぼ同程度となっている。

第1の割型1Aにおける凹部11Aの表面粗さRaを、第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面粗さRaよりも大きくすることで、溶融石10 鹸をキャビティ内に充填し冷却固化させた後に成形型を型開するときに、表面粗さRaの低い第2の割型1B側に石鹸が常に保持されることが本発明者らの検討の結果判明した。

凹部の表面粗さRaを低下させるとその割型側に石鹸が保持され、逆に凹部の表面粗さRaを大きくするとアンカー効果によってその割型側に石鹸が保持されることは先に述べた通りである。つまり表面粗さRaの大小によって石鹸が保持される割型がまちまちとなってしまう。本発明者らが鋭意検討した結果、第1の割型1Aにおける凹部11Aの表面粗さRa(つまり高表面粗さの領域の表面粗さRa)と、第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面粗さRaとの差を0.1~30μm、好ましくは0.2~20μmとすることで、表面粗さRaの低い第2の割型1B側に石鹸が常に保持されることが判明した。

図1に示されるように、第1の割型1Aの凹部11Aに形成される高表面粗さの領域は、該凹部11Aの底面に位置している。つまり高表面粗さの領域は、成形型のパーティング面PLとほぼ平行な面である凹部 11Aの底面に形成されている。これによって、第1の割型1Aからの

石鹸の離型が容易となり、第2の割型1B側に石鹸が一層確実に保持される。ほぼ平行な面の定義は先に述べた通りである。

第2の割型1B側に石鹸を一層確実に保持させるために、第1の割型1Aの凹部11Aにおける高表面粗さの領域は、該凹部11Aの全面積の30%以上、特に50%以上を占めることが好ましい。最も好ましくは、第1の割型1Aの凹部11Aはその全域が高表面粗さの領域となっている。

また、第2の割型1B側に石鹸を一層確実に保持させるために、第1の割型1Aの凹部11Aにおける高表面粗さの領域は、その表面粗さR a が 0 . 2 ~ 3 0 μm、特に 0 . 4 ~ 2 0 μmであることが好ましい。一方、第1の割型1Aにおける凹部11Aの低表面粗さの領域の表面粗さR a 及び第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面粗さR a は何れも 0 . 1 ~ 3 0 μm、特に 0 . 1 ~ 2 0 μmであることが好ましい。なお、第1の割型1Aにおける凹部11Aの低表面粗さの領域の表面粗さR a と、第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面粗さRaとは必ずしも同じ値であることを要しない。

更に、第2の割型1B側に石鹸を一層確実に保持させるために、第1の割型1Aの凹部11Aにおける高表面粗さの領域の表面粗さRaと、第2の割型1Bにおける凹部11Bの表面粗さRaとの比(前者/後者)は2~300、特に4~200であることが好ましい。

本実施形態の成形型を用い、これを図2に示す製造装置に取り付けて 石鹸を製造すると、成形型内で石鹸が成形された後に両割型1A,1B を型開すると、石鹸5は常に第2の割型1B側に保持される。

本発明は前記実施形態に制限されない。例えば前記実施形態において

は2個の割型で一組をなす成形型を用いたが、割型の数はこれに限られず石鹸の形状によっては3個以上の割型から成形型を構成してもよい。その場合には、複数の割型のうち、一の割型における凹部の表面積を、残りの各割型における凹部の表面積よりもそれぞれ大きくすることが好ましい。これに代えて、複数の割型のうち、一の割型における凹部の少なくとも一部の表面粗さを高くし、且つ残りの各割型における凹部の表面粗さをそれよりも低くし、しかも残りの各割型における凹部の表面粗さをそれぞれ同程度とすることも好ましい。

また図1に示す実施形態においては第2の割型1Bの凹部底面に高表 10 面粗さの領域を形成したが、該領域は同実施形態に必須のものではな く、各割型1A,1Bの凹部11A,11Bは同程度の低表面粗さにし ておいてもよい。

また図1及び図3に示す実施形態においては、髙表面粗さの領域は、パーティング面PLとほぼ平行な面である凹部底面に形成されていた が、髙表面粗さの領域の形成箇所はこれに限られず凹部における他の領域、例えばパーティング面PLとほぼ直角な面であってもよい。更に凹部底面に形成する場合は、底面の全域に髙表面粗さの領域を形成することに代えて、該底面に不連続に髙表面粗さの領域を複数箇所形成してもよい。

20 また、各割型1A, 1 Bの凹部11 A, 1 1 Bには、石鹸の確実な保持(第1の割型側)及び石鹸の確実な離型(第2の割型側)を目的として、空気の吸引用及び吹き出し用のスリットや小孔を形成してもよい。同様に図3に示す実施形態においても、石鹸の確実な保持(第2の割型側)及び石鹸の確実な離型(第1の割型側)を目的として、各割型に空25 気の吸引用及び吹き出し用のスリットや小孔を形成してもよい。

20

2.5

グリセリン

また前記実施形態においては、圧縮成形の一例である気泡入り石鹸の 製造に本発明の成形型を用いたが、本発明の成形型は気泡を含まない通 常の石鹸の製造に用いることもできる。尤も、本発明の成形型は、冷却 後のヒケの大きい気泡入り石鹸の製造のような圧縮成形に特に適してい る。

以下実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明 の範囲はかかる実施例に制限されるものではない。特に断らない限り 「部」は「重量部」を意味する。

〔実施例1-1〕

201に示す成形型を用い、これを図2に示す製造装置に取り付けて気 泡入り石鹸を製造した。第1の割型における凹部の表面積と第2の割型 における凹部の表面積との比は53:47であった。各割型の凹部を鏡 面加工して表面粗さRaが0.463μmの低表面粗さの領域を形成し た。但し第2の割型においては、凹部の底面をサンドブラスターによる 15 粗面化処理して表面粗さRaが18.93μmの高表面粗さの領域を形 成した。第2の割型の凹部における高表面粗さの領域は、該凹部の全面 積の48%を占めていた。

以下に示す配合成分を用いて、前述した特開平11-43699号公報に記載の方法に従い無数の気泡が分散含有された溶融石鹸を調製した。発泡には窒素ガスを用いた。

20部

ラウリン酸 N a3 0 部ココイルイセチオン酸 N a2 部ラウロイル乳酸 N a5 部ポリオキシエチレンモノラウレート2 部ラウリン酸5 部

塩化ナトリウム

1.5部

香料

1.5部

水

15

3 2 部

調製された溶融石鹸を用い、図2(a)~図2(d)に示す工程に従い気泡入り石鹸を製造した。溶融石鹸の温度は64℃とした。各割型は5~15℃の冷却水で冷却しておいた。溶融石鹸の冷却時間は1分とした。冷却後に成形型を型開し、どちらの割型に石鹸が保持されているかを観察した。5回の成形を行ったところ、5回とも第1の割型側に石鹸が保持されたことを確認した。

10 〔実施例1-2〕

第1の割型における凹部の表面積と第2の割型における凹部の表面積との比を5.7:4.3とした。また、各割型の凹部を鏡面加工して表面粗さ R a が 0.26.3 μ m の低表面粗さの領域を形成した。但し第2の割型においては、凹部の底面をサンドブラスターによる粗面化処理して表面粗さ R a が 0.46.3 μ m の高表面粗さの領域を形成した。これ以外は実施例1-1と同様にして気泡入り石鹸を製造した。 5 回の成形を行ったところ、5 回とも第1の割型側に石鹸が保持されたことを確認した。

〔実施例1-3〕

20 第1の割型における凹部の表面積と第2の割型における凹部の表面積との比を66:34とした。各割型の凹部を鏡面加工して表面粗さRaが0.263μmの低表面粗さの領域を形成した。但し第2の割型においては、凹部の底面をサンドプラスターによる粗面化処理して表面粗さRaが18.93μmの高表面粗さの領域を形成した。これ以外は実施25 例1-1と同様にして気泡入り石鹸を製造した。5回の成形を行ったところ、5回とも第1の割型側に石鹸が保持されたことを確認した。

[実施例1-4~1-6]

実施例1-1~1-3において第2の割型に高表面粗さの領域を形成しない以外は実施例1-1~1-3とそれぞれ同様にして気泡入り石鹸を製造した。各実施例についてそれぞれ5回の成形を行ったところ、各実施例の何れにおいても、5回とも第1の割型側に石鹸が保持されたことを確認した。

〔実施例2-1〕

図3に示す成形型を用い、これを図2に示す製造装置に取り付けて気 泡入り石鹸を製造した。各割型の凹部を鏡面加工して表面粗さRaが 0・463μmの低表面粗さの領域を形成した。但し第1の割型におい ては、凹部の底面をサンドブラスターによる粗面化処理して表面粗さR aが18・93μmの高表面粗さの領域を形成した。第1の割型の凹部 における高表面粗さの領域は、該凹部の全面積の48%を占めていた。

以下に示す配合成分を用いて、前述した特開平11-43699号公 15 報に記載の方法に従い無数の気泡が分散含有された溶融石鹸を調製し た。発泡には窒素ガスを用いた。

	ラウリン酸 N a		3	0 部
	ココイルイセチオン酸 N a			2 部
	ラウロイル乳酸Na			5 部
20	ポリオキシエチレンモノラウレー	٢		2 部
	ラウリン酸			5 部
	グリセリン		2	0 部
	塩化ナトリウム	1.		5 部
	香料	1.		5 部
25	水		3	2 部

調製された溶融石鹸を用い、図2(a)~図2(d)に示す工程に従

い気泡入り石鹸を製造した。溶融石鹸の温度は64℃とした。各割型は 5~15℃の冷却水で冷却しておいた。溶融石鹸の冷却時間は1分とし た。冷却後に成形型を型開し、どちらの割型に石鹸が保持されているか を観察した。5回の成形を行ったところ、5回とも第2の割型側に石鹸 が保持されたことを確認した。

〔実施例2-2〕

各割型の凹部を鏡面加工して表面粗さRaがO.263μmの低表面粗さの領域を形成した。但し第1の割型においては、凹部の底面をサンドプラスターによる粗面化処理して表面粗さRaがO.463μmの高 表面粗さの領域を形成した。これ以外は実施例2-1と同様にして気泡入り石鹸を製造した。5回の成形を行ったところ、5回とも第2の割型側に石鹸が保持されたことを確認した。

[実施例2-3]

各割型の凹部を鏡面加工して表面粗さ R a が 0 . 2 6 3 μ m の低表面 粗さの領域を形成した。但し第 1 の割型においては、凹部の底面をサンドプラスターによる粗面化処理して表面粗さ R a が 1 8 . 9 3 μ m の高 表面粗さの領域を形成した。これ以外は実施例 2 - 1 と同様にして気泡 入り石鹸を製造した。 5 回の成形を行ったところ、 5 回とも第 2 の割型 側に石鹸が保持されたことを確認した。

20 [比較例1]

25

第1の割型における凹部と第2の割型における凹部とを対称形の同形にしてそれらの表面積を同じにし、且つ第2の割型に高表面粗さの領域を形成しない以外は実施例1-1と同様にして気泡入り石鹸を製造した。10回の成形を行ったところ、第1の割型側に石鹸が保持された回数が4回、第2の割型側が6回であった。

WO 2004/090087 PCT/JP2004/004807

18

産業上の利用可能性

本発明の成形型によれば、型開時に、成形された石鹸が常に特定の割型に保持される。従って本発明の成形型を用いれば石鹸の製造を安定的に且つ生産性良く行うことができる。本発明の成形型は、気泡入り石鹸の製造のような圧縮成形に特に適している。

請求の範囲

- 1. 一組の割型を組み付けてなり、内部に成形用のキャビティが形成される石鹸の成形型において、一の割型における前記キャビティを形成する凹部の表面積を、他の各割型における前記キャビティを形成する凹部の表面積よりもそれぞれ大きくし、一の割型における前記凹部の表面積と、他の各割型における前記凹部の表面積との比をそれぞれ52:48~66:34とした石鹸の成形型。
 - 2. 2個の割型で一組をなす請求の範囲第1項記載の石鹸の成形型。
- 3.他の各割型における前記キャビティを形成する凹部の表面粗さRa 10 を、一の割型における前記キャビティを形成する凹部の表面粗さRaよ りも大きくし、それらの表面粗さRaの差を0.1~30μmとした請 求の範囲第1項記載の石鹸の成形型。
- 4.他の各割型における前記キャビティを形成する凹部には高表面粗さの領域と低表面粗さの領域とがあり、該低表面粗さの領域における表面 15 粗さRaが、一の割型における前記キャビティを形成する凹部の表面粗さRaとほぼ同程度となっている請求の範囲第3項記載の石鹸の成形型。
- 5. 前記凹部に、成形型のパーティング面とほぼ平行な面が形成されて おり、該面に前記高表面粗さの領域が形成されている請求の範囲第4項 20 記載の石鹸の成形型。
 - 6.他の各割型における前記髙表面粗さの領域が、凹部の全面積の30% 以上を占めている請求の範囲第4項記載の石鹸の成形型。

WO 2004/090087 PCT/JP2004/004807

20

- 7. 他の各割型における前記高表面粗さの領域の表面粗さRaが0. 2 ~30μmであり、前記低表面粗さの領域の表面粗さRa及び一の各割型における凹部の表面粗さRaが何れも0. 1~30μmである請求の範囲第4項記載の石鹸の成形型。
- 5 8. 一組の割型を組み付けてなり、内部に成形用のキャビティが形成される石鹸の成形型において、一の割型における前記キャビティを形成する凹部の表面粗さRaを、他の各割型における前記キャビティを形成する凹部の表面粗さRaよりもそれぞれ大きくし、それらの表面粗さRaの差それぞれを 0. 1~30μmとした石鹸の成形型。
- 10 9. 一の割型における前記キャビティを形成する凹部には高表面粗さの 領域と低表面粗さの領域とがあり、該低表面粗さの領域における表面粗 さRaが、他の各割型における前記キャビティを形成する凹部の表面粗 さRaとほぼ同程度となっている請求の範囲第8項記載の石鹸の成形 型。
- 15 10. 前記凹部に、成形型のパーティング面とほぼ平行な面が形成されており、該面に前記高表面粗さの領域が形成されている請求の範囲第9項記載の石鹸の成形型。
 - 11.一の割型における前記髙表面粗さの領域が、凹部の全面積の30%以上を占めている請求の範囲第9項記載の石鹸の成形型。
- 20 12. 一の割型における前記高表面粗さの領域の表面粗さRaがO. 2 ~30μmであり、前記低表面粗さの領域の表面粗さRa及び他の各割型における凹部の表面粗さRaが何れもO. 1~30μmである請求の範囲第9項記載の石鹸の成形型。

- 13.2個の割型で一組をなし、それぞれの割型における凹部がほぼ対称な同形状をしている請求の範囲第8項記載の石鹸の成形型。
- 14. 請求項1又は8記載の成形型のキャビティ内に溶融石鹸を加圧注入し、該溶融石鹸を圧縮状態下に冷却固化させた後、該成形型を型開して固化した石鹸を取り出す石鹸の製造方法。
 - 15. 前記溶融石鹸が、無数の気泡を分散含有するものである請求の範囲第14項記載の石鹸の製造方法。
- 16. 前記石鹸の表層部は固化しているが、内部は未固化の状態で前記成形型を型開する請求の範囲第14項記載の石鹸の製造方法。

Fig.1

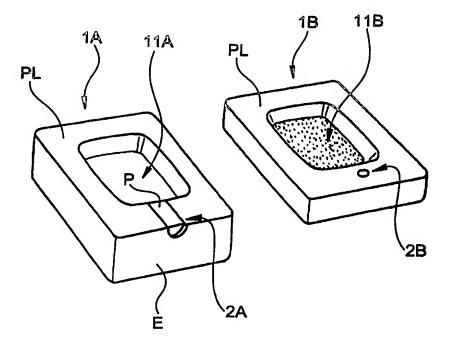
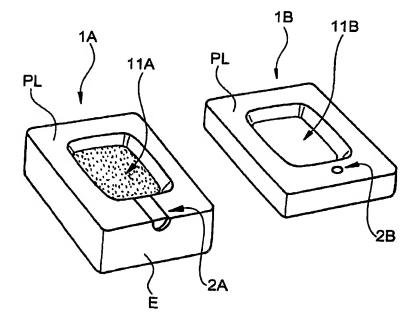
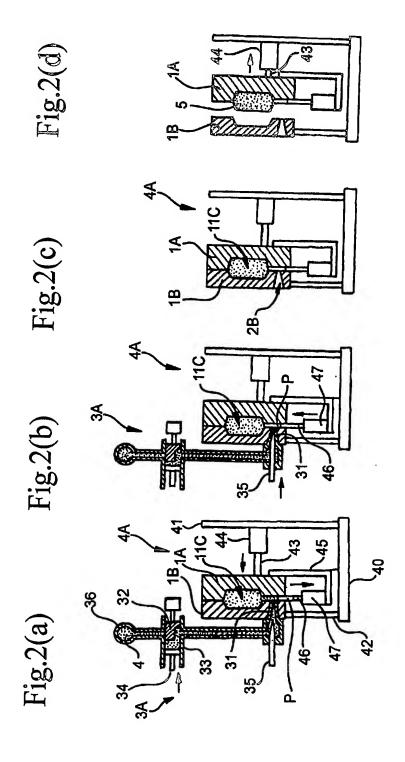


Fig.3





International application No.

PCT/JP2004/004807

A. CLASSIF	CATION OF SUBJECT MATTER	102/02	2004/00480/	
Int.Cl	.7 C11D13/16		_	
{				
According to Ir	ternational Patent Classification (IPC) or to both natio	nal classification and IPC		
B. FIELDS S.				
Minimum dans	EARCHED			
Tn+ C1	mentation searched (classification system followed by	classification symbols)		
1 -1110.01	7 C11D1/00-19/00, A61K7/00-7/	50, A61K9/00-9/72, A23G1	/00-9/30,	
	A23P1/00-1/16, C08J5/00-5/2	2, B29C39/00-43/58		
			•	
Documentation	searched other than minimum documentation to the ex	tent that such door		
ĺ	and the same of the same of the same of	tent that such documents are included in the	e fields searched	
	•		-	
Electronic data	haca consulted during the first of	·		
2.00 a o inc data	base consulted during the international search (name or	f data base and, where practicable, search te	rms used)	
			-	
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
		·		
Category*	Citation of document, with indication, where a	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X	JP 2002-167599 A (KAO CORP.) _	· ·	
Y	11 June, 2002 (11.06.02).	•	1-2,14-16	
	Abstract; Par. No. [0023]: F	ia. 1:	3-16	
	Par. Nos. [0035] to [0036]:	Figs. 2 to 3		
	& WO 2002/24858 A1 & ER	2 1239027 A1	•	
X	JP 2002-167598 A (KAO CORP.),	1-2,14-16	
Y	1 11 June, 2002 (11.06.02).	•	3-16	
	Abstract; Par. No. [0035]; F	ig. 3; Par. No. [0043]	3 10	
	& WO 2002/24427 A1 & EE	P 1352726 A1		
v	TD 0000 1 cm			
X Y	JP 2002-167597 A (KAO CORP.),	1-2,14-16	
T	11 June, 2002 (11.06.02),		3-16	
	Abstract; Par. No. [0035]; F. & WO 2002/24856 A1 & EP	ig. 3	•	
	& WO 2002/24656 AI & EP	1229105 A1		
		1		
		1		
X Further do	Cumonto and links 1. 11			
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categ "A" document de	gories of cited documents:	"T" later document published after the inter	national filing data as with the	
	cfining the general state of the art which is not considered cular relevance	uate and not in commet with the annical	100 but cited to understand	
"E" earlier applic	E" earlier application or matery but with the			
ming date	ming date			
"L" document w	"document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as president as the publication date of another citation or other special reason (as president as the publication date of another citation or other special reason (as president as the publication date of another citation or other special reason (as president as the publication date of another citation or other special reason (as president as the publication date of another citation or other special reason (as president as publication date of another citation or other special reason (as president as			
opeoidi iedao	ii (as specificu)	"Y" document of particular relevance; the cla	imed invention cannot be	
"O" document rei	erring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	combined with one or more other such d	ocuments such combination	
the priority d	blished prior to the international filing date but later then	being obvious to a person skilled in the a	urt .	
p u		"&" document member of the same patent far	mily	
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search				
TIGHT 11 117 OCC AR AA.				
17 August, 2004 (17.08.04)				
Nome on A 12				
Name and mailing	ame and mailing address of the ISA/ Authorized officer			
vapanes	e Patent Office		İ	
Facsimile No.				
orm PCT/ISA/210	(second sheet) (January 2004)	Telephone No.		
	(Silvery (January 2004)			

International application No.
PCT/JP2004/004807

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim
Y	JP 8-127800 A (KAO CORP.), 21 May, 1996 (21.05.96), Abstract; Par. No. [0021]; (particularly, the last sentence); Fig. 5 (Family: none)	1-16
· Y	JP 2001-525881 A (UNILEVER N.V.), 11 December, 2001 (11.12.01), Abstract; page 27, lines 12 to 18; Fig. 9 (a reference cited in the specification of the present application) & WO 98/50393 A1 abstract; page 31, lines 14 to 21; Fig. 9	1-16
Y .	JP 2002-121599 A (KAO CORP.), 26 April, 2002 (26.04.02), Abstract; Claim 2; Par. No. [0013]; Fig. 1 (a reference cited in the specification of the present application) (Family: none)	1-16
P,Y	JP 2003-277799 A (KAO CORP.), 02 October, 2003 (02.10.03), Abstract; Claim 1; Par. Nos. [0037] to [0038]; Figs. 3, 9, 18, 19 (Family: none)	1-16
P,X P,Y	JP 2003-129096 A (KAO CORP.), 08 May, 2003 (08.05.03), Abstract; Par. No. [0022]; Fig. 1; Par. No. [0038]; Figs. 4 to 5 (Family: none)	1-2,14-16 3-16
P,Y	JP 2003-277798 A (KAO CORP.), 02 October, 2003 (02.10.03), Abstract; Par. No. [0038]; Figs. 9, 3, 12 & US 2003/180411 A1	1-16
P,Y	JP 2004-2717 A (KAO CORP.), 08 January, 2004 (08.01.04), Abstract; Par. No. [0044]; Figs. 9, 3, 12 (Family: none)	1-16
A·	JP 11-34079 A (KAO CORP.), 09 February, 1999 (09.02.99), Abstract; Par. No. [0001] (Family: none)	1-16
-	·	·

International application No. PCT/JP2004/004807

Box No. II	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
1. C	ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons: claims Nos.: ecause they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
be	claims Nos.: ecause they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
	laims Nos.: ecause they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box No. II	where daily of invention is lacking (Continuation of item 5 of first sneet)
	ational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
2. × As any 3. As	s all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable aims. all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of y additional fee. s only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers ly those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No No res	required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is tricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on 1	Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

International application No. PCT/JP2004/004807

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

The invention of Claims 1-2 relates to a soap-molding die where the surface area of a recess forming a cavity in one split die is made greater in a range of a predetermined ratio than the surface area of a recess forming a cavity in each of the other split dies.

The invention of Claims 8-13 relates to a soap-molding die where the surface roughness Ra of a recess forming one split die is made greater in a range of a predetermined numerical values than the surface roughness Ra of a recess forming a cavity in each of the other split dies.

The two invention groups above use different means so that a piece of soap molded is always held by a predetermined die when the molding die is opened.

However, the invention corresponding to the soap-molding die of Claims 1-2 is publicly known and lacks novelty because it is disclosed in each of the documents (JP 2002-167599 A, JP 2002-167598 A, and JP 2002-167597 A) shown in Box C. Therefore, there is no technical relationship between the two inventions involving the same or corresponding "special technical feature clearly indicating contribution that each of the inventions as a whole makes over the prior art" (PCT Rule 13.2), and the two inventions are not so linked as to form a single general inventive concept (PCT Rule 13.1).

In Claims 3-7 dependent on Claim 1, the feature corresponding to the technical feature of Claim 8 is added and defined, so that the invention of Claims 3-7 is a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept together with Claims 8-13.

The method of producing soap described in Claims 14-16 includes the invention using the molding die of Claim 1 and the invention using the molding die of Claim 8. The inventions are not a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

		国際出願番号 PCT/JP20	04/004807
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(I PC))		
Int. Cl7 C	11D 13/16		
D ====================================	65 A 10 FF		
調査を行った	行った分野 最小限資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl' C1	11D 1/00 - 19/00, A61K 7/00 - 7/50, A61K 9/08J 5/00 - 5/22, B29C 39/00 - 43/58	9/00 - 9/72, A23G 1/00 - 9/30, A23F	P 1/00 - 1/16,
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
国際調査で使	用した電子データベース (データベースの名称		
,			
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-167599 A (KAO CORPORATION), 200	02. 06. 11,	1-2, 14-16
Y	要約,段落[0023],図1,段落[0035]-[0036 & WO 2002/24858 A1,	5],図2-3, L	3-16
Χ .	JP 2002-167598 A (KAO CORPORATION), 2002.06.11,		
Y	要約,段落[0035],図3,段落[0043],		1-2, 14-16 3-16
	& WO 2002/24427 A1,	, ,	
X. Y	JP 2002-167597 A (KAO CORPORATION), 200	22. 06. 11,	1-2, 14-16
	要約, 段落[0035], 図3, & WO 2002/24856	6 A1, & EP 1229105 A1	3-16
X C欄の続き	にも文献が列挙されている。		紙を参照。
*. 引用文献の	ウカテゴリー	の日の後に公表された文献	
もの	のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「丁」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって
「E」国際出願 以後に公	質日前の出願または特許であるが、国際出願日 < <p>○表されたもの</p>	出願と矛盾するものではなく、3 の理解のために引用するもの	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			
文献 (理由を付す)			
「O」口頭によ 「P」国際出願 ————	る開示、使用、展示等に言及する文献 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献	はめてある組合せにある
国際調査を完了した日 06.07.2004 国際調査報告の発送日 17.8.2004		. 2004	
日本国	名称及びあて先 特許庁 (ISA/JP) 便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 井上 典之	4 V 9 3 6 0
東京都 	千代田区霞が関三丁目 4番 3 号	電話番号 03-3581-1101	内線 3483
式PCTノエ	SA/210 (第2ページ) (2004年15		

			04/004807	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示			
Y	JP 8-127800 A (KAO CORPORATION), 1996.05.21, 要約, 段落[0021](特に末文), 図5, (ファミリーなし)		1-16	
Y	JP 2001-525881 A (UNILEVER N. V.), 2001. 12. 11, 要約, 27頁12-18行, 図9, (本願明細書中で引用), & WO 98/50393 A1, 要約, 31頁14-21行, 図9			
У	JP 2002-121599 A (KAO CORPORATION), 2002.04.26, 要約,請求項2,段落[0013],図1,(本願明細書中で引用),(ファミリーなし)			
РУ	JP 2003-277799 A (KAO CORPORATION), 2003.10.02, 要約,請求項1,段落[0037]-[0038],図3,図9,図18,図	③19, (ファミリーなし)	1-16	
PX PY · ·	JP 2003-129096 A (KAO CORPORATION), 2003.05.08, 要約,段落[0022],図1,段落[0038],図4-5,(ファミリ	ーなし)	1-2, 14-16 3-16	
PY∙	JP 2003-277798 A (KAO CORPORATION), 2003.10.02, 要約,段落[0038],図9,図3,図12, & US 2003/180411	A1	1-16	
РУ	JP 2004-2717 A (KAO CORPORATION), 2004.01.08, 要約,段落[0044],図9,図3,図12,(ファミリーなし)	·	1–16	
Α -	JP 11-34079 A (KAO CORPORATION), 1999.02.09, 要約, 段落[0001], (ファミリーなし)	·	1-16	
	·			
		,	-	
		·		

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. □ 請求の範囲 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. □ 請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. □ 請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
(別紙参照)
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. 図 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
」 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった
追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

第Ⅲ欄の続き

請求の範囲1-2に記載の発明は、一の割型におけるキャビティを形成する凹部の表面積を、他の各割型におけるキャビティを形成する凹部の表面積よりも、特定比率の範囲内で大きくした石鹸の成形型に関するものである。

請求の範囲 8-13 に記載の発明は、一の割型におけるキャビティを形成する凹部の表面粗さ Ra を、他の各割型におけるキャビティを形成する凹部の表面粗さ Ra よりも、特定の数値範囲内で大きくした石鹸の成形型に関するものである。

上記2つの発明群は、型開時に成形された石鹸が常に特定の割型に保持されるようにするために、それぞれ 異なる手段を採用したものである。

請求の範囲1に従属する請求の範囲3-7については、請求の範囲8に記載の技術的特徴に対応する事項が付加限定されているため、請求の範囲8-13と単一の一般的発明概念を形成するように関連している一群の発明であると認められる。

請求の範囲14-16に記載の石鹸の製造方法には、請求の範囲1に記載の成形型を用いるものと、請求の 範囲8に記載の成形型を用いるものが含まれており、両者は単一の一般的発明概念を形成するように関連して いる一群の発明であるとは認められない。